

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 2 月 4 日 (2016.2.4)

【公開番号】特開 2014-127532 (P2014-127532A)

【公開日】平成 26 年 7 月 7 日 (2014.7.7)

【年通号数】公開・登録公報 2014-036

【出願番号】特願 2012-281837 (P2012-281837)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/68 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/02 B

H 0 1 L 21/68 F

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 12 月 11 日 (2015.12.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の基板と第 2 の基板とを互いに重ね合わせる基板処理装置であって、
前記第 1 の基板を保持する第 1 ステージと、
前記第 2 の基板を保持し、前記第 1 ステージに向けて移動して前記第 1 の基板および前記第 2 の基板を互いに重ね合わせる第 2 ステージと、
前記第 2 ステージの位置を測定する測定部と、
前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との接触による前記測定部の振動を抑制する振動抑制部と、
を備える基板処理装置。

【請求項 2】

前記振動抑制部は、前記接触により前記第 1 ステージに生じた振動が前記測定部に伝達されることを抑制する請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 3】

前記振動抑制部は、前記第 1 ステージと前記測定部との間で振動が伝達される経路に配置され、前記第 1 ステージから伝達される振動を減衰させる制振部を含む請求項 2 に記載の基板処理装置。

【請求項 4】

前記制振部は、前記振動を減衰させるマスダンパおよびアクティブマスダンパの少なくとも一方を含む請求項 3 に記載の基板処理装置。

【請求項 5】

前記振動抑制部は、前記測定部に伝達された前記振動を抑制する請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

前記振動抑制部は、前記振動を減衰させるマスダンパおよびアクティブマスダンパの少なくとも一方を含む請求項 5 に記載の基板処理装置。

【請求項 7】

前記振動抑制部は、前記測定部を含む振動の系の固有振動数を変化させる付加質量を含

む請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 8】

前記第 1 ステージを支持する枠体を備え、

前記測定部は、前記枠体に支持される請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 9】

前記測定部は、前記第 2 ステージに設けられた反射鏡に測長ビームを照射する干渉計である請求項 1 から 8 のいずれか一項に記載の基板処理装置。